Molecular Dynamics of Nucleation of SWNT from a Metal Cluster on a Substrate

機正 *澁田 錆 (東大院) 伝正 丸山 茂夫 (東大院)

Yasushi SHIBUTA and Shigeo MARUYAMA

Dept. of Mech. Eng., The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

Nucleation process of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) from a transition metal cluster on a substrate is studied using classical molecular dynamics (MD) simulation. For describing the effect of the substrate, averaged one-dimensional Lennard-Jones potential is employed between the metal cluster and the bottom boundary of the simulation cell. The parameters of the 1D L-J potential describe the different phase of wettability. Aggregation process of carbon atoms from Ni₁₀₈, Ni₂₅₆ and Ni₅₀₀ clusters on a substrate are compared. Moreover, wettability of the Ni cluster and the Ni-Carbide cluster is compared by MD simulation of annealing process on a substrate.

Key Words : Single-Walled Carbon Nanotubes, Molecular Dynamics, Nucleation, Clustering Process

1. はじめに

単層カーボンナノチューブ(SWNTs)⁽¹⁾の合成手法は,触媒 CVD 法^(2,3)の開発等により、その低コスト大量合成が現実味 を帯びてきた.しかし現在の段階では、直径やカイラリティ (巻き方)の制御には至っておらず、これらの実現のためには SWNT の生成メカニズムの解明が必至である.

著者はこれまで浮遊した(気相中の)触媒金属からのナノチ ューブ生成初期過程を分子動力学法シミュレーションによ り再現し、その生成機構を検討してきた(4).一方、近年著者 らが開発したアルコールを原料とした触媒 CVD 法⁽³⁾により, 触媒金属を担持した基板から高純度の垂直配向 SWNT の生 成⁽⁵⁾が可能になった.しかし触媒を担持している基板がナノ チューブ生成に与える影響に関しては未解明な部分が多い. 本研究では、分子動力学法シミュレーションにより、孤立炭 素が基板に担持された遷移金属クラスターを核として凝縮 し、 ナノチューブ生成初期過程にみられるキャップ構造を形 成する過程を再現し、その生成機構について考察する.

2. 計算方法

基本的な計算手法は既報⁽⁴⁾と同様である、炭素間共有結合 ポテンシャルとして Brenner ポテンシャル⁽⁶⁾を,金属炭素, 金属金属間ポテンシャルには著書らが開発した多体ポテン シャル⁽⁷⁾を用いた.異なる分子の炭素間の van der Waal 力は Lennard-Jones ポテンシャル($\varepsilon = 2.4 \text{ meV}, \sigma = 3.37 \text{ Å}$)で表現し た.本研究では、立方体セルの上下面のみ鏡面反射を用い、 他の四面は周期境界を使用した.また鏡面反射を施したセル の下面と金属原子の間に一次元平均壁面ポテンシャル

$$F(z) = 4\pi\rho\varepsilon\sigma^2 \left\{ \frac{1}{5} \left(\frac{\sigma}{z}\right)^{10} - \left(\frac{\sigma}{z}\right)^4 \right\}$$
(1)

を施すことにより, 基板上に担持された金属クラスターを表 現した. 無限平面上に分子が数密度ρで平均的に敷き詰めら れたものを仮定している. 運動方程式の数値成分には修正 Verlet 法を用い,時間刻みは 0.5 fs とした. 温度制御に関し ては,擬似的に平衡条件を実現するため,系の並進,振動, 回転エネルギーに対して, 独立に Berendsen 法⁽⁸⁾(τ = 0.17 ps) を施した.

3. 基板上の触媒金属クラスターのアニール

始めに, 面心立方格子(fcc)構造に配置した Ni₁₀₈, Ni₂₅₆, Ni₅₀₀を 2000 K で 2 ns アニールして触媒金属クラスターの初 期構造を決定した. さらに得られたクラスターを, 金属原子 との間に一次元壁面ポテンシャルを施した壁面上でさらに 100ps アニールして、基板上に担持されたクラスターの初期 構造を作成した.式(1)で示される一次元平均壁面ポテンシャ ルは $z = \sigma$ のとき最小値をとる.この値の絶対値 E_{max} が0.25eV,



(b) Potential energy per metal atom of the cluster. Fig. 1 Anneal of metal cluster on a substrate.

0.49eV, 0.98eV の3つの条件でアニールを行った. また金属 炭素混合クラスターNi₂₅₆C₃₀₀についても同様の3条件でアニ ールを行った.

100 ps アニールした後の Ni₂₅₆及び Ni₂₅₆C₃₀₀の様子を図1 (a)に示す.Ni クラスターの場合, *E_{max}*が大きくなるにつれて クラスターの形状が変化し濡れ性の違いが顕著に現れる.一 方,炭素金属クラスターでは条件の範囲ではクラスターの形 状に顕著な差は見られなかった.金属クラスターに炭素が混 ざることにより生じる炭素金属間結合によって,金属原子1 個辺りのポテンシャルエネルギーが大きく低下することが クラスターをより硬くしていると考えられる(図 1(b)).また Ni₂₅₆クラスターのエネルギーの時間発展を見ると,クラスタ ーが濡れるにつれて,金属原子1個辺りのポテンシャルエネ ルギーが高くなる.これは配位数の小さい金属原子の数が相 対的に多くなるためである.よって金属原子のポテンシャル エネルギーは,濡れることによって壁面との間の引力によっ て得られるエネルギーよりも,金属結合間ポテンシャル由来 のエネルギーが主だと考えられる.

4. 基板上の金属における炭素凝縮過程のシミュレーション 前項で得られた Ni₁₀₈, Ni₂₅₆, Ni₅₀₀の初期構造を,一辺 20 nm の前述の境界条件を満たす立方体セルの底面に配置し,孤立 炭素原子 500 個をランダムに配置し(図 2),制御温度 2500K で計算を行う.図3に3つの壁面条件(*E_{max}*=0.98,0.49,0.25eV) における Ni₂₅₆の時間発展のスナップショットを示す.壁面 と金属原子とのポテンシャルが強くなるにつれて,壁と平行 な方向に(111)結晶が並びやすくなり,それに沿うようにグラ ファイト構造が形成される.その結果,*E_{max}*=0.98eV(濡れ性 大)の場合,壁と平行なグラファイト構造ができる.金属ク ラスター内の炭素が飽和すると,クラスターの端からはみ出 した2枚のグラファイトがつながるが,クラスターの大部分 からはみ出ているため,キャップ構造は形成しない(図 4).



Fig. 2 Initial condition of aggregation process of carbon atoms. E_{max}=0.98eV Side View



Fig. 3 Snapshots of aggregation process of carbon atoms in the metal cluster on the substrate.

一方, *E_{max}=0.25eV(濡れ性小)の場合, 壁面と金属とのポテンシャルが弱いため, 当初のクラスター構造を維持している.* これにより,壁と平行なグラファイト構造はできにくく, 飽 和し析出した炭素はキャップ構造を形成する.この過程は既 報⁽⁴⁾と同様のプロセスを経ている.

図5にクラスターを形成する炭素原子と金属原子の比,及 び,金属原子一個辺りのポテンシャルエネルギーの時間発展 を示す.壁面と金属原子のポテンシャルが強いほど,クラス ター内により多くの炭素原子が取り込まれる.これは上述の ように、ポテンシャルが強いほど、壁と平行な方向にグラフ ァイトが形成されやすくなるためである.しかし、ポテンシ ャルが強すぎるとナノチューブのキャップ構造は形成され ないため、ナノチューブ生成の最適条件として、壁面と金属 原子のポテンシャルが強すぎない(濡れ性が大きくない)こと が予想される.

4. まとめ

分子動力学法シミュレーションにより,基板上の金属クラ スターに炭素が凝縮し,過飽和になった炭素が析出する過程 を再現し,ナノチューブの生成初期過程に基板が与える影響 について考察した.クラスターの濡れ性が大きいと,壁面と 平行にグラファイトが形成されやすく,グラファイトの生成 速度は速いがキャップ構造を形成しないことが分かった.

参考文献

 S. Iijima *et al.*, Nature, **363** (1993), 603. (2) H. Dai *et al.*, Chem. Phys. Lett., **260** (1996), 471. (3) S. Maruyama *et al.*, Chem. Phys. Lett., **360** (2002), 229. (4) Y. Shibuta *et al.*, Chem. Phys. Lett., **382** (2003), 381. (5) Y. Murakami *et al.*, Chem. Phys. Lett., **385** (2004), 298. (6) D. W. Brenner, *Phys. Rev. B*, **42**, 9458 (1990). (7) Y. Yamaguchi *et al.*, Euro. Phys. J. D, **9** (1999), 385. (8) H.J.C. Berendsen *et al.*, J. Chem. Phys. **81** (1984), 3684.



Fig. 4 Top view of Ni_{256} cluster after 40 ns calculation.



Fig. 5 Dissolution of carbon atoms into metal cluster.